Коротковолновый излучатель на системе полос молекул хлорида аргона (175 nm) и хлора (258 nm) с накачкой наносекундным барьерным разрядом

© А.К. Шуаибов, А.И. Миня, Р.В. Грицак, З.Т. Гомоки

Ужгородский национальный университет, 88000 Ужгород, Украина e-mail: shuaibov@univ.uzhgorod.ua

(Поступило в Редакцию 14 мая 2013 г.)

Представлены эмиссионные характеристики импульсно-периодического источника УФ–ВУФ-излучения с накачкой барьерным разрядом наносекундной длительности, который излучает на системе электронно-колебательных полос с максимумами при $\lambda = 175$ nm ArCl(B \rightarrow X) и $\lambda = 258$ nm Cl₂(D' \rightarrow A'). Проведена экспериментальная оптимизация интенсивности излучения молекул ArCl и Cl₂ в зависимости от давления и состава смеси аргона с парами фреона (CCl₄), а также условий возбуждения.

Использование "жидких" газовых сред на основе фреона — CCl₄ и инертных газов имеет ряд преимуществ при использовании в эксиплексных излучателях на хлоридах тяжелых инертных газов, в том числе и сложных — Xe₂Cl* [1]. Хлорсодержащие фреоны успешно применялись в импульсных УФ-ВУФ-лампах на монохлоридах Хе и Кr с накачкой поперечным объемным разрядом и искровой УФ-предыонизацией [2-4]. Для продвижения в область вакуумного ультрафиолета в работах [5,6] предложено было использовать в эксиплексных лампах с поперечным разрядом рабочие среды вида He-Ar-(HCl, Cl₂, CCl₄, CF₂Cl₂), позволяющие получать интенсивное излучение полос 175 nm ArCl $(B \rightarrow X)$, и 258 nm $Cl_2(D' \rightarrow A')$. В работе [7] было показано, что ArCl — лампа с накачкой объемным разрядом имеет энергию в импульсе ~ 0.6 mJ при пиковой плотности мощности ~ 0.4 kW/cm². Излучение хлорида аргона всегда сопровождается интенсивной полосой молекулы хлора — 258 nm $Cl_2(D' \rightarrow A')$, которая по величине длины волны близка к резонансной спектральной линии атома ртути (253 nm), широко применяемой в различных оптических технологиях, базирующихся на разного типа ртутных лампах.

По сравнению с эксимерными ксеноновыми лампами (172 nm Xe₂^{*}), излучатели на хлориде аргона и хлора имеют более дешевую рабочую среду, а использование высококачественного кварца с пропусканием до $\Delta \lambda = 150-160$ nm позволяет разрабатывать ArCl-лампы барьерного разряда с большой величиной рабочей поверхности.

Общим недостатком эксиплексных ламп с поперечным разрядом и оголенными металлическими электродами является малая рабочая апертура, что связано с их конструкцией и низкий ресурс работы в газостатическом режиме, что обусловлено взаимодействием агрессивного хлорносителя с поверхностью металлических электродов.

Характеристики импульсно-периодического барьерного разряда на основе смеси Ar-CCl₄, который может быть использован в качестве двухволновой лампы на полосах хлорида аргона и хлора, в настоящее время не исследованы.

В настоящей статье приводятся результаты оптимизации УФ–ВУФ-излучателя на системе полос 175 nm $ArCl(B\to X)$ и 258 nm $Cl_2(D'\to A')$ с накачкой наносекундным барьерным разрядом.

Импульсно-периодический разряд с двумя диэлектрическими барьерами зажигался в цилиндрической колбе из кварца марки КУ-1. Рабочая длина колбы — 20 ст, а диаметр внутренней трубки из кварца — 14 тт. Межэлектродное расстояние в разряде составляло примерно 4.5 mm. Внутренний электрод излучателя был изготовлен в виде сплошного цилиндра из алюминия и устанавливался во внутреннюю кварцевую трубку. Внешним электродом служила спираль из никелевого провода, прозрачность которой составляла ≈ 80%.

Импульсно-периодический барьерный разряд зажигался при помощи источника импульсов высокого напряжения с резонансной перезарядкой накопительного конденсатора емкостью 1.54 nF и коммутатором — водородным тиратроном ТГИ—I-1000/25. Амплитуда импульсов напряжения на выходе модулятора увеличивалась при помощи импульсного кабельного трансформатора примерно в три раза и достигала 40—55 kV при длительности отдельного выброса на уровне 5—20 пs. Амплитуда основного максимума импульса тока достигала 50 A при его длительности 20—30 ns. Система регистрации излучения описана в [8].

На рис. 1, *a*, *b* представлены спектры излучения плазмы барьерного разряды в смесях Ar–CCl₄, в которых фиксированное парциальное давление паров жидкого фреона и разные давления аргона. При малом давлении смеси (p(Ar) = 5-10 kPa) (рис. 1, *a*) в спектрах излучения наблюдались соизмеримые по интенсивности излучения полосы с максимумами при $\lambda = 175$ nm ArCl(B \rightarrow X) и $\lambda = 258$ nm Cl₂(D' \rightarrow A') [4,9]. Менее интенсивным было излучение полос эксиплексной молекулы при $\lambda = 169$ nm ArCl(D \rightarrow X) и 199 nm



Рис. 1. Спектры излучения импульсно-периодического барьерного излучателя в смесях $p(Ar) - p(CCl_4) = 6.7 - 0.13$ (*a*), 54.4-0.13 kPa (*b*).

 $ArCl(C \rightarrow A)$ [10,11], которое проявлялось только при низком давлении рабочей смеси. Наиболее интенсивной в спектре излучения была полоса молекулы хлора с $\lambda = 258 \,\mathrm{nm} \,\mathrm{Cl}_2(\mathrm{D}' \to \mathrm{A}'),$ которая начинала превалировать при высоком давлении смеси (p > 20-30 kPa). Особенностью спектра УФ-излучения является наличие неразрешенного выступа в коротковолновом канте полосы излучения молекулы хлора, который более сильно проявлялся при увеличении давления смеси и который не наблюдался при использовании простых хлорсодержащих молекул (HCl, Cl₂) [7]. Эти особенности УФ-излучения молекулы хлора могут быть связаны с вкладом излучения продуктов распада молекул CCl₄ (радикалов CC1* или атомов углерода), которые образуются при их диссоциации в барьерном разряде [11]. При увеличении парциального давления паров фреона до 0.3 kPa в спектре УФ-ВУФ-излучения разряда остается только одна полоса молекулы хлора (258 nm) (рис. 1, *b*).

Исследование зависимостей интенсивности излучения полосы ArCl(B \rightarrow X) в плазме барьерного разряда от парциального давления паров фреона (при давлении аргона 24 kPa) показало, что оптимальное давление паров CCl₄ находится в диапазоне 150–180 Pa. Зависимость интенсивности полосы молекулы хлора с увеличением парциального давления паров CCl₄ увеличивалась примерно линейно.

Увеличение парциального давления аргона от 10 до 55 kPa в разряде на смеси Ar–CCl₄ показало, что интенсивности полос ArCl($B \rightarrow X$) (*a*) и Cl₂($D' \rightarrow A'$) (*b*) уменьшается: полосы 258 nm — примерно в три раза, а полосы — 175 nm на два порядка (рис. 2).

Зависимости интенсивностей излучения полос 175 nm (a) и 258 nm (b) от частоты следования импульсов (рис. 3) показали, что при малых частотах (40–350) Hz наблюдаются нелинейные зависимости от частоты, а средняя интенсивность излучения небольшая. В области частот 400–1000 Hz наблюдались зависимости интенсивности близкие к линейным и значительное увеличение их величины. Такой характер зависимостей интенсивностей связан вероятно с распадом молекул CCl₄ в разряде при большой частоте повторения импульсов накачки.

Таким образом, исследование эмиссионных характеристик излучателя барьерного разряда на смеси аргона



Рис. 2. Зависимости интенсивности полос 175 nm $ArCl(B \rightarrow X)$ (*a*) и 258 nm $Cl_2(D' \rightarrow A')$ (*b*) от величины давления аргона при парциальном давлении фреона $p(CCl_4) = 0.13$ kPa.



Рис. 3. Зависимости интенсивности полос 175 nm $ArCl(B \rightarrow X)$ (*a*) и 258 nm $Cl_2(D' \rightarrow A')$ (*b*) в барьерном разряде в смеси $p(Ar)-p(CCl_4) = 13.3-0.13$ kPa от частоты повторения импульсов.

Журнал технической физики, 2014, том 84, вып. 1

с парами CCl₄ показало, что он является селективным УФ-ВУФ-излучателем полос хлорида аргона (175 nm) и хлора (258 nm); вариацией парциального давления фреона возможно получение излучения на двух или одной (258 nm) длине волны; оптимальное содержание паров фреона находится в диапазоне 150–180 Ра, а давления аргона — 5-10 kPa; наибольшая средняя мощность излучения достигается при работе в частотном режиме 400–1000 Hz.

Список литературы

- Миськевич А.И., Цзиньбао Го. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. Вып. 8. С. 33–39.
- [2] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 2. С. 77–81.
- [3] Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // Квант. электрон. 2000. Т. 30. № 3. С. 279–281.
- [4] Бойченко А.М., Ломаев М.М., Панченко А.Н., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. Ультрафиолетовые и вакуумноультрафиолетовые эксилампы: физика, техника и применение. Томск; SST, 2011. 512 с.
- [5] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Неймет Ю.Ю., Шевера И.В. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. Вып. 11. С. 29–33.
- [6] Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // ПТЭ. 2000. № 3. С. 101– 103.
- [7] Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф. // Квант. электрон. 2006.
 Т. 36. № 2. С. 169–173.
- [8] Шуаибов А.К., Миня А.И., Гомоки З.Т., Шевера И.В., Грицак. Р.В. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. Вып. 3. С. 64–67.
- [9] Kogelschatz U. // J. Opt. Technol. 2012. Vol. 79, N 8. P. 484–493.
- [10] Gundel L.A., Setser D.W., Clyne M.A.A., Coxon J.A., Nip W. // J. Chem. Phys. 1976. Vol. 64. N 11. P. 4390–4410.
- [11] Tsuji M., Furusawa M., Mizuguchi T., Muraoka T., Nishimura Y. // J. Chem. Phys. 1992. Vol. 97. N 1. P. 245–255.